

Vier-Spitzen-Messköpfe

Alle Standard Messköpfe besitzen in Diamant geführte und in Reihe liegende Messspitzen, die in einem Aluminiumgehäuse eingebaut sind. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Spitzen beträgt 1 mm, d.h. der Gesamtabstand zwischen den beiden äußeren Spitzen ist 3 mm. Die Andruckkraft für die Messspitze wird oben am Probenkopf eingestellt.

Ein Vier-Spitzen-Messkopf wird immer zu einem Gerät mitgeliefert womit in der Regel die meisten Messungen durchgeführt werden können. Weiter sind von den vordefinierten Typen abweichende Messkopfgeometrien auf Anfrage erhältlich.

Typ	Anwendung	Material	Spitzenradius	Kraft
A	Metallfilme, ITO, amorphes Si, Polysilizium, SOI, Substrate	Wolfram-Karbid	25 µm	60-150 g
B	General Purpose: EPI Schichten, diffundierte Schichten, Metallfilme	Wolfram-Karbid	100 µm	60-150 g
M	EPI, diffundierte und implantierte Schichten (50 nm bis 5 µm), sehr flach ionenimplantierte Schichten	Wolfram-Karbid	300 µm	60-150 g
N	Sehr flach implantierte Schichten	Wolfram-Karbid	500 µm	60-150 g
K & L	Poly Si, EPI Schichten, Metallfilme, tief ionenimplantierte Schichten	Wolfram-Karbid	300 µm	60-150 g
C	III-V Verbindungshalbleiter, z.B. GaAs, InAs	Osmium	100 µm	60-150 g
Quecksilber	USJ, Ultra dünne Schichten	Hg		~0
Custom			Nach Wunsch	